



To Our Stakeholders

— 社長メッセージ —

Challenge to the Future

**最先端の技術追求と
マーケティングの進化によって
社会との共有価値を創造し、
持続的成長に邁進します。**

代表取締役 取締役社長

種市順昭

The Cutting Edge

グローバルリスクの拡大と社会への貢献

世界を覆う気候変動リスクと感染症リスクが、拡大の一途にあります。2019年の世界の平均気温は観測史上2番目に高かったほか^{*1}、2020年1月のダボス会議における議論の焦点は、気候変動問題が大部分を占めました。また、2019年11月に第1号症例が確認された新型コロナウイルス感染症は想定以上のスピードで拡散し、合計感染者数が785万人、死亡者数が43万人^{*2}を超える「100年に一度の危機」として、世界のヒト、モノ、カネの動きの大部分を止めたまま、いまだ収束の兆しが見えていません^{*2}。

創業者・向井繁正が創業時より唱えてきた経営理念のもと、あらゆる経営資源や取り組みを「社会への貢献」に帰結させる「統合思考」を継承してきた東京応化は、こうしたグローバルリスクの拡大に怯むことなく、80年間のたゆまぬ研鑽を続けてきた世界最高水準の微細加工技術と高純度化技術による価値創造に邁進し、危機下および危機後の人類社会の課題解決と、持続的発展に貢献してまいります。

^{*1} 出典：世界気象機関 (WMO) ^{*2} 出典：厚生労働省2020年6月15日リリース

ブルーオーシャン戦略で最先端の価値創造を継続

企業や社会のあらゆる産業にデジタルトランスフォーメーション(DX)の波が押し寄せており、今回のコロナ禍を機に、DXが加速することは間違いないと考えています。東京応化が長年にわたり培ってきたコアコンピタンスを駆使して生み出す製品は、DXに必須となる半導体の高性能化を通じ、新型コロナウイルスだけでなく様々な社会的課題の解決や、人々の豊かな暮らしに貢献できるものです。

例えば、気候変動シミュレーションの精緻化を担う世界最速の最先端スーパーコンピュータの心臓部に、東京応化のフォトレジストを用いた先端半導体デバイスが搭載されています。国内研究機関に設置されているこのスーパーコンピュータは、「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」をはじめとする研究開発を加速し、環境政策や防災へ貢献していく見込みです。

また、新型コロナウイルスの治療薬やワクチンの開発を

支えるスーパーコンピュータにも、東京応化のフォトレジストを用いた先端半導体デバイスが搭載されています。米国の国立研究所に設置されているこのスーパーコンピュータは、新型コロナウイルスの感染能力を弱める可能性がある薬剤や天然化合物を発見し、同研究所ではこれら化合物の検証を中心に、新型コロナウイルスの治療薬やワクチンの開発に向けた研究が進められています。

加えて、コロナ禍を契機とする在宅勤務やリモートワークの導入に伴い、データセンターやネットワーク関連の増強は、「アフターコロナ」の世界で中長期的に継続する可能性があります。そこで必須となる最先端半導体の多くに、東京応化のフォトレジストが用いられています。

このように、DXに欠かせない半導体デバイスの材料として、様々な社会的課題の解決に陰ながら貢献している当社のフォトレジストの多くは、営業・開発・製造の三位一体のコミュニケーションによるマーケティング戦略のもと、10年先のブルーオーシャンに的を絞り、ロングランの開発の結果高いシェアを獲得している製品です。今後も、顧客、市場、社会との対話に基づくブルーオーシャン戦略のもとでロングランの研究開発を継続し、様々な最先端分野における高付加価値の提供に邁進してまいります。

ロングランの研究開発を支える理念

最先端の価値創造を支える当社の無形資産として、経営理念の1つである「自由闊達」な社風があります。東京応化には、自由闊達な雰囲気の中で様々な研究開発やマーケティングにチャレンジし、「机の下での研究」も認め合う風土があります。

例えば、スマートフォン等モバイルデバイスに欠かせないSAW^{*1}・BAW^{*2}フィルター向け材料として強いポジションを獲得しているMEMS^{*3}材料は、ドライフィルム事業のノウハウをベースに「机の下での研究開発」を10数年続け、技術者自らがマーケティングをしながら世界中に売り歩くなど、自由なチャレンジを継続した結果収益の柱へと成長した製品です。

また、私自身も入社20年目に新規事業開発に転じた際、上司に「2年間遊んでいろ。何をやってもいいから好きに遊べ」と言われ、2年間真剣に遊ばせてもらいました。最

先端の技術シーズにまつわる世界中の学会を飛び回るとともに、そこで得た情報を社内で共有しながら賛同者を増やし、いくつもの新規事業を企画していきました。その時期に立ち上げた3次元実装装置「Zero Newton®」やナノインプリント材料は、市場の顕在化が10年以上先と見込まれていたにも関わらずリソースを割き、自由にチャレンジすることができた結果、今後の当社の事業ポートフォリオ変革につながる技術シーズに育っています。

*1 表面弾性波フィルター

*2 バルク弾性波フィルター

*3 Micro Electro Mechanical Systems

開発部門における人材施策の強化

マテリアリティの1つとして「人材施策の強化」に取り組む当社は、自由闊達な風土を大切にだけでなく、開発担当者へのインセンティブにおいても、ロングランの研究開発を支える仕組みを構築しています。開発期間が10年以上におよぶ製品が開花する頃には、基本特許を取得した人材がそのプロジェクトを離れているケースもあるため、特許取得者と収益を密接にリンクさせながら金銭で報いる「実績報奨制度」を2018年から運用し、ロングランの研究開発を奨励しています。また2019年には、卓越した能力と実績を有する人材について、管理職にならずとも役員級として処遇するエグゼクティブフェロー制度を導入し、開発者としての道を存分に究めることができる体制としました。

そして、こうした理念や仕組みのもと、東京応化のチャレンジが大きく結実しつつある事例が、EUV用フォトレジストです。

時代の最先端を切り開く EUV用フォトレジスト

世界で最も微細な回路線幅を実現するEUVリソグラフィが2019年より普及期に入り、当社のEUV用フォトレジストは大手半導体メーカーに採用いただき世界トップシェア*1を有しておりますが、ここに至る道のりは長く、困難を極めるものでした。

EUVリソグラフィによる半導体(7nm)は従来のArFによる半導体(10nm)に比べ処理能力が20~30%向上し、消費電力も50~60%小さくなるため、人々のより便利で

快適な生活と環境社会の創出に大きく貢献することができます。しかし、回路パターンを形成するための光がArFの僅か14分の1しかないことが最大のボトルネックとなり、従来とは全く異なるアプローチで臨む必要がありました。そこで当社は、原材料であるポリマーの設計を根本的に見直しながら大学ほか研究機関とのオープンイノベーションのもとで独自設計するとともに、フォトレジストの反応性を磨きあげ、お客様に採用いただくことができました。

開発期間が足掛け20年弱にわたった同フォトレジストは、当社の最先端かつロングランの価値創造の象徴であり、マテリアリティ「イノベーションに資する高付加価値製品の開発・提供」の最大の実践事例であると申し上げます。EUVによる7nm半導体は既に一部の5G対応デバイスに搭載されているほか、今後5nm半導体が量産されるに伴い、AI、HPC*2、車載デバイス等にも幅広く使われていく見込みです。また、現在開発中の3nm半導体を実現すれば、さらに便利で快適、かつ環境に優しい世界の創出に貢献できる見込みです。今後も、あらゆる産業の進化と技術イノベーションに、東京応化が貢献していることを楽しみにしております。

*1 2019年の見込み販売数量シェア(出典:富士キメラ総研「2020年エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」)

*2 High Performance Computing:スーパーコンピュータなどの高性能コンピュータにより、膨大な数の計算や処理を行うこと

半導体の技術進化に材料・装置の 両面で貢献し持続的成長を実現

ここまでご紹介してきた東京応化のフォトレジストは、いずれも高付加価値材料として、半導体製造における「前工程」「後工程」で必要な材料です。当社は今後も半導体の微細化、高密度化や3次元化といった技術進化に材料・装置の両面で貢献し続けることで成長を加速していきます。また、こうした技術転換スピードの速い分野だけでなく、世界最高水準の高純度化技術によって高純度化学薬品(洗浄液、シンナー、現像液等)を製造・提供することで、安定的な収益も実現していきます。そして、このビジネスモデルで稼いだ資金をさらなる最先端分野や新規事業開発に再投入し、事業ポートフォリオの変革を継続することで、持続的な成長を実現していきます。

tok中期計画2021

「tok中期計画2021」1年目の総括

2020年の「ありたい姿」として掲げてきた長期経営ビジョン『高付加価値製品による感動を通じて、世界で信頼される企業グループを目指す。』のもと、定性目標『TOKグループがやるべきニッチな市場を開拓する。』を掲げて4つの全社戦略に取り組む「tok中期計画2021」の1年目であった2019年12月期は、米中貿易摩擦の影響やスマートフォン需要の落ち込み、サーバー市場の成長鈍化等から半導体市場が縮小し、減収減益となりました。一方、EUV用フォトレジストの採用が拡大したほか、ArF用フォトレジストが中国市場向けに伸長し、KrF用フォトレジストは3D-NAND向けに拡大するなど、多くの先端分野で、今後につながる成果をあげることができました。また、韓国拠点(TOK尖端材料社)の生産設備の拡張や、次世代技術の開発拠点である相模事業所の新研究開発棟の建設など、中長期的成長を見据えた投資も着実に進めることができました。

中期計画の2年目となる2020年12月期は、外部環境におけるVUCA*の様相がますます強まる見込みですが、以下のリスクと機会を認識しながら事業ポートフォリオ変革に注力し、5G・IoT社会に向けたビジネスチャンスを最大限に捉えてまいります。

* Volatility (変動性)、Uncertainty (不確実性)、Complexity (複雑性)、Ambiguity (曖昧性)

“VUCAの時代”において東京応化を取り巻くリスクと機会

米国・中国をはじめとする主要国の争いの背景には、データ経済の進展に伴うデータ主権の争いが色濃く横たわっていると分析しています。中国の大手半導体メーカーがコロナ禍においても工場を稼働させ続けた事実からも分かる通り、データ経済の根幹を担う半導体産業は各国でエッセンシャル・ビジネスに位置づけられており、よって長期的な成長トレンドが続く見込みです。米国・中国・韓国・台湾に顧客密着拠点を展開する当社は、今後も半導体技術の最先端を走るお客様と並走しながら、オーダーメイドの先端材料をタイムリーに提供することで事業機会を取り込んでいきます。中国市場での展開については、米中貿易摩擦や新型コロナウイルスの影響が続く見込みではあるものの、お客様との密なコミュニケーションや営

業・マーケティングのもと、リスク以上に見込める機会を取り込み、成長ポテンシャルを追求していきます。

日本政府の主導によって2019年7月から始まった韓国向け輸出管理の厳格化については、当事者の1社として輸出手続きによる業務は増加したものの、業績へのマイナス影響はありませんでした。また、当社が2012年に韓国に開発・製造拠点を開設し、韓国顧客や韓国籍従業員との信頼関係を築き、現地コミュニティに根を下ろしてきたこともプラスに作用しています。今後も各種リスク動向を注視しながら、当社ならではの高付加価値製品を開発・提供し続けることで、機会を最大化していきます。

新型コロナウイルスの感染拡大については、現時点*1において治療法やワクチン開発の目処が立っていないことから、第2波の到来も含め長期化するリスクに備えています。人的資本の安全を守りながら、人類の進化に欠かせない半導体産業の一翼を担うフォトレジストの世界トップシェアメーカー*2として、社会的責任と公共的使命を果たしてまいります。また、リモートワークの普及といった人々の行動変容による半導体需要の拡大を事業機会として着実に取り込むとともに、逆に半導体市場の大幅な落ち込み等によって売上が長期的に減少したとしても、当社の生命線である研究開発活動が制限されぬよう、昨年公表したキャッシュリザーブ・ポリシーのもと、「リスク対応資金」など強固な財務基盤を活かしていきます。

(→P48-51「CFOメッセージ」ご参照)

*1 2020年6月15日現在

*2 2019年の見込み販売数量ベース(富士キメラ総研「2020年エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」を基に当社算出)



韓国・TOK尖端材料社

成長ドライバー「5G」「AI」 「パワーデバイス」

半導体産業は、足元においてはコロナ禍による渡航制限の影響等から先端分野の開発・生産に遅れが見られるものの、中長期的には、「5G」「AI」「パワーデバイス」等を成長ドライバーとして着実に成長していく見込みです。当社は引き続き、企業理念を再解釈した事業コンセプト「新技術にチャレンジし、技術を磨き、持続可能な地球のために、社会の期待に化学で応える」のもと、価値創造機会を積極的に捉えてまいります。

5G: 今後10年間における最も重要な社会インフラ

「高速・大容量」「低遅延」「多数同時接続」といった特性によりIoTやデータ経済を大きく進展させる5Gは、今後10年間における最も重要な社会インフラの1つとして、遠隔医療の普及や自動運転、物流や建設現場の人手不足の解決等を通じ、人類社会に様々な恩恵をもたらす見込みです。また、足元でサービスが始まっている5G対応スマートフォンだけでなく、今後は製造現場などBtoB領域におけるローカル5Gやエッジコンピューティング*の市場がより大きな成長を遂げる見込みです。それに伴い、新たな技術課題が生まれ、より多くの、より高性能な半導体が必要とされていく見込みであることから、当社は、EUV用・ArF用などの先端フォトレジストや機能性表面処理剤、パッケージ材料やMEMS材料等を開発・提供していくほか、アンテナ関連デバイス向けの機能性フィルム、センシングデバイス向けのナノインプリント材料など、新規事業分野での開発も強化していきます。

(→P32-33「特集」ご参照)

*センサーやデバイス等からのデータを、発現場に近い場所で処理する手法や技術

AI: ソフトウェアの進化に化学で応える

AIを構成するソフトウェアの進化に伴い、データ処理・データ伝送の高速化が進むことから、EUV用・ArF用フォトレジストや機能性表面処理剤、パッケージ材料やMEMS材料等のほか、3次元実装装置の開発・提供も強化していきます。また、ストレージの大容量化が進むことから、3D-NAND向けKrF用フォトレジストのさらなる強

化にも取り組みます。足元ではAI用の最先端DRAMに複数の材料を採用いただくなど当社製品は堅調に推移しており、社会や産業により多くのAIが浸透していくことを見据え、製品を進化させ続けていきます。

パワーデバイス: 多くのお客様と長期持続的成長へ

各種省エネ機器や再生エネルギーシステムの心臓部を担うパワー半導体は、気候変動リスクの低減において重要な役割を果たします。当社はパワー半導体の製造に欠かせないg線・i線用フォトレジストの世界トップシェアメーカーであるほか、プラズマアッシング装置やウエハハンドリングシステムなど、パワー半導体向け装置においても強みを持ちます。当分野における技術転換スピードは5GやAIに比べやや緩やかではあるものの、イノベーションは着実に起きており、次世代パワー半導体であるSiC(炭化ケイ素)パワー半導体向けのフォトレジストや表面処理剤等の開発に注力しています。また、パワーデバイス分野は材料、装置の両セグメントにおいてお客様の数が多く、お付き合いも長期におよぶことが多いため、信頼関係を長く維持することで、長期持続的成長を目指していきます。

(→P34-35「特集」ご参照)

装置事業

装置事業については、3次元実装装置がOSAT*メーカー向けに納入実績とシェアを伸ばしているほか、2019年12月期はパワーデバイス向けのプラズマアッシング装置が伸長したものの、ここ数年はセグメント損失が続いております。しかし、関連子会社の吸収合併や経費削減、メンテナンス等のアフターサービス、さらにはプロトタイプを作る前のデータ上の試作工程の強化等によって収益構造の改善が進んでいます。また、半導体の先端分野の進展に伴い、材料、装置の双方においてニーズが細分化する傾向にあることから、材料の特性を最大限に引き出すためのプロセスをご提案する当社ならではのM&E (Materials & Equipment) 戦略が、大手装置メーカーの参入が難しいニッチな分野にブルーオーシャンを見出し得る可能性があると考えております。当社の企業価値向上に寄与できるよう、早期黒字化を通過点に、将来の

* Outsource Assembly and Test : 半導体の生産のみを受託する事業モデルのうち、後工程のみを行う業態

ブルーオーシャンを見据えた取り組みも継続していきます。

新規事業

事業ポートフォリオ変革の一端を担う新規事業については、中期計画における重点分野として掲げている「機能性フィルム」「ライフサイエンス関連材料」「光学部材」のいずれにおいても成果をあげることができました。

当社がかつてプリント基板分野で培ったドライフィルムの製造技術と、LCD製造装置分野で培ったスピンレスコーターの技術を多孔質ポリイミドに応用した「機能性フィルム」は、従来のモバイル端末や自動車向けよりも格段に高い耐久性が求められる特殊用途において、リチウムイオン電池用セパレーターとしての採用が始まっています。

「ライフサイエンス関連材料」については、当社のMEMS構造形成材料によって微細かつ複雑な構造を実現した「バイオチップ製造用材料」が最先端のDNAシーケンサー向けに採用され、新型コロナウイルスのゲノム解析やワクチンの開発にも用いられています。また、同じくMEMS構造形成材料を用いた「細胞配列チップSIEVEWELL™」を当社ブランドとして発売し、患者様の負荷が小さい病理診断や、創薬研究の支援ツールとして貢献しています。

光をコントロールする材料として開発に注力してきた「光学部材」については、2018年に出資したPixelligent Technologies, LLC (米国)とのオープンイノベーションが奏功し、光の屈折率をコントロールすると同時に高い透明性や耐久性も備えたUVナノインプリント材料として、AR・VR端末や3Dセンサー等に用いられています。これらデバイスの5G対応が進めば市場はさらに広がる見込みであり、こうしたオープンイノベーションの成功事例を他の様々な領域で増やしていくことで、技術シーズを拡充し、長期持続的成長へとつなげていきます。

成長市場における 研究開発投資・設備投資

足元の新型コロナウイルスによる影響も注視しつつ、対象市場は成長分野であるという基本認識のもと、5G・AI分野における先端材料のさらなる強化に向けて、研究開発投資・設備投資を進めています。3nm向けの採用獲得に注力しているEUV用フォトレジストでは、新たな素材開

発を目的に新たなオープンイノベーションを拡充しているほか、64層、96層に続き100層台でも採用を獲得できた3D-NAND向けKrF用フォトレジストでは、増産へ向けた設備投資を続けています。また、高純度化学薬品については、先端分野向けの洗浄液の増産に備えた生産能力の増強や、機能性表面処理剤の強化へ向けた研究開発投資にも注力しています。

持続的価値創造へ向けた 「4つの全社戦略」

2019年1月からの「tok中期計画2021」のスタートと同時に社長に就任した私は、こうした事業戦略や投資計画を着実に進める一方、東京応化が今後も事業環境の激しい変化へ迅速に対応し、持続的な価値創造を実現していくための「4つの全社戦略」について、各部署・事業本部や現場の最前線とともに様々な角度から議論を重ね、以下の取り組みを進めました。

高純度化を突き詰める

全社戦略①：顧客の声を的確に捉え、迅速に応え、顧客とのパイプを、より太く、より強いものとする
一顧客満足に徹したサポート体制ならびに研究開発に迅速かつ着実に取り組む

就任当初より「お客様と社会の期待に化学で応える」ことを前面に打ち出した私は、国内外のお客様を営業・開発担当者とともに訪問するなど、お客様とのパイプをより太く、強くするための活動に注力しました。世界の最先端を走るお客様のニーズを直接お聞きする中で打ち出した方針の1つが、「高純度化をとことんまで突き詰める」ということです。最先端半導体の品質や歩留りを大きく左右する高純度化(不純物の徹底的な低減)について、原料の精製段階から開発と製造が一体となり、不純物を極限まで



低減することを目標としたプロジェクトを本年1月より開始しました。相模事業所の新研究開発棟に設置したスーパークリーンルームも駆使し、世界最高水準の品質を提供できるTOKブランドの定着と盤石化を図ります。



相模事業所・
新研究開発棟

森を見ながら木を育てる マーケティングを推進

全社戦略②:マーケティングを強化し、顧客の価値創造プロセスへの理解を深め、新たな価値創造に結び付ける一徹的なマーケティングにより、顧客の新たな価値創造につながるソリューションを見極め、集中的かつ積極的に対応する

最先端分野にまつわるコミュニケーションをお客様と重ねる中で、「森を見ながら木を育てるマーケティング」の重要性を痛感しています。顧客密着戦略を展開してきた当社は、「木を育てる」ことにかけては着実に強みを磨いてきたと自負していますが、今後の最先端分野でさらに競争力を高めていくには、森(エレクトロニクス市場全体や技術動向の全体像、社会的課題や社会動向全体)を俯瞰する能力を強化する必要があります。そこで2020年1月、「ストラテジック・アライアンス部」を社長直轄組織として立ち上げ、5年先を見据えた経営目線のマーケティングの強化に注力しています。まずは同部によって「森を見ながら木を育てるマーケティング」を定着させ、その後、営業本部全体による活動に落とし込んでいく構えです。

人材が高いモチベーションを 持ち続ける仕組みを構築

全社戦略③:自ら調べ、自ら判断し、自ら行動できる人材を強化する一様な顧客とのビジネスの可能性を追求し、成功するまで挑戦を続ける人材を強化する

東京応化が今後も最先端の価値創造を続けていくには、経営理念「自由闊達」をさらに進化させねばならないとい

う思いが全社戦略③の根底にあります。つまり、「自ら調べ、自ら判断し、自ら行動し、成功するまで挑戦を続ける」ことこそが今後の東京応化が追い求めていくべき「自由闊達」であり、2019年12月期は、従業員エンゲージメント調査によって課題を洗い出し、目指すべき方向性を深く議論しました。2020年12月期は、その成果を土台に具体的な制度の構築を進め、「人材が高いモチベーションを持ち続けること」「人材の幸福度増進とそれによる企業価値向上」に主眼を置いた新人事制度と人材育成プログラムを、2021年12月期から運用する予定です。

ROE等も評価指標とする 新・役員報酬制度を開始

全社戦略④:tok経営基盤を強化する一グループマネジメントのさらなる高度化とコーポレート・ガバナンスの充実ならびに経営資源のより効率的な活用を目的としたバランスシートマネジメントの推進に注力する

さらなる進化に取り組んできたコーポレート・ガバナンスについては、2018年12月に設置した「指名報酬諮問委員会」を中心とする新たな取り組みが着実に進み、2020年3月には取締役会に独立取締役を1名増員し社外取締役比率が3分の1になったほか、指名報酬諮問委員会の過半数が社外取締役となりました。また、社外取締役や外部コンサルタントの意見を取り入れながら策定・導入した新・役員報酬制度においては、年次賞与や業績連動型株式報酬が数値目標の達成度に応じ0~200%の広い範囲内で変動する仕組みとしたほか、業績連動型株式報酬の評価指標の1つをROE等とするなど*、役員が当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に深くコミットすることを促す仕組みとしました。

財務・資本政策については、引き続きバランスシートマネジメントの強化に取り組みます。自由闊達な価値創造を持続するための財務基盤の整備とステークホルダーの皆様との対話に注力し、超長期の目線でバランスシートのあるべき姿についての議論を続けながら、「投資」「キャッシュリザーブ」「株主還元」のベストバランスを追求していきます。また、当中期計画とともに開始した「DOE3.5%を目標とする配当方針」も継続していきます。

*当初の業績評価期間は2020年12月期から2021年12月期の2年間とし、当該期間についてはROE等を評価指標の1つとする

統合思考の進化と 社会との共有価値の創造に向けて

企業価値向上に向けた重要課題 (マテリアリティ)—1年目の総括

当社は今後も、創業者・向井繁正による4つの経営理念と統合思考のもと、優れた高付加価値の製品を供給することで社会との共有価値を創造し、持続的な企業価値向上を実現してまいります。

そのための指針として昨年策定したマテリアリティへの取り組みについて、2019年12月期は様々な成果があり、足元においても重要なテーマが着実に進捗しています。「人材施策の強化」においては、本年3月、当社初となる女性幹部として女性人事部長が就任しました。また、「環境保全」においては、TCFD*に沿った情報開示へ向けた取り組みを開始したほか、「労働安全衛生・保安防災」については、ISO45001の取得拠点が本年から来年にかけて加速度的に増える計画です。そして、「イノベーションに資する高付加価値製品の開発・提供」「コーポレート・ガバナンスの充実」における成果や今後の取り組みについては、既にご紹介してきた通りです。

設立80周年となる2020年12月期においては、80周年のコンセプトワードである“SHINKA”のもと、事業のみならず、マテリアリティやSDGs、CSRへの取り組みも新たなプロジェクトによって体系的に強化することで、「進化・新化・深化」を図っていきます。また、80年間成長してきた源泉を再度見つめ直すことで当社の「真価」を磨くほか、10年後の2030年および20年後の「100年企業」を見据えた施策を着実に実行し、将来の価値創造基盤を強化しながら、全ての人材が成功するまで芯をもって挑戦を続ける「芯化」も実現していきます。

*Task Force on Climate-related Financial Disclosures: 気候変動関連財務情報開示タスクフォース

「TOK Vision 2030」— 豊かな未来、社会の期待に化学で応える “The e-Material Global Company” を目指す

2010年に策定した2020年の「ありたい姿」への取り組みも、本年度で最終年度を迎えています。現在、2030年への長期ビジョンとして、新たな定量目標を含む「TOK Vision 2030」の策定が最終段階にあります。その全体像や詳細な内容は来年度発行する「統合レポート2020」にてお伝えしますが、当レポートでは、先にその基本的な考え方を、ステークホルダーの皆様と共有させていただきます。

2020年8月より、当社グループは、「豊かな未来、社会の期待に化学で応える“The e-Material Global Company”」を目指し、電子材料分野のさらなる深耕と開拓に邁進します。具体的には、半導体製造における前工程の進化は今後も続き、後工程の進化も続くほか、その周辺材料についても進化が続くという基本認識のもと、前工程では1nmを見据えたさらなる微細化、後工程では2.5Dパッケージや3Dパッケージの進化、周辺材料では新たな洗浄液等へのニーズに応えていきます。

そして、その根底に据えるのは、創業以来受け継いできた統合思考のもと、社会的な重要課題の解決に持続的に貢献し、世界のステークホルダーから信頼され、顧客が感動する新しい付加価値を提供することで「豊かな未来、社会の期待に化学で応える」という哲学です。

これからも、東京応化の価値創造にぜひご期待ください。

